原子状水素による Mg₂Si の熱電性能向上化について

1. 背景

LSI用高純度シリコン(以降Si)の11Nや太陽 電池用Siの10Nに比べて熱電素子の純度は3N から4Nで利用できるため、LSI用シリコンイン ゴットからウェハ加工時に生じるSi切粉にフ ッ酸洗浄を行うことで、シリサイド系熱電材料 のケイ化マグネシウム(以降Mg2Si)の出発材料 として再利用可能となる。

Mg2Siは、人体や自然環境に有害な成分を含まない環境調和型半導体の一つで、廃材の再利用、廃熱の再利用の観点から盛んに研究が行われている。

2. 目的

熱電素子の性能を示す熱電性能指数Zは次 式で求められる。但し、ゼーベック係数S[V/K]、 導電率 σ [S/m]、熱伝導率 κ [$W/m \cdot K$]とする。

$$Z = \frac{S^2 \sigma}{\kappa} \tag{1}$$

式(1)より、Sと σ は高く、 κ は低いほど熱電 素子の性能は増加する。しかし、本研究室の Mg2SiはS、 σ が非常に低く、このため、同様に 熱電性能も低い。これは、Mg2Si合成時に酸化 マグネシウム(以降MgO)が生成するためであ る。MgOは絶縁体であるため、Mg2Si内に大量 に存在すると熱電性能を低下させる。本研究 では、熱電性能向上のために、原子状水素を用 いてMgOの除去を行うことを目的とする。

3. 実験方法および測定方法

3.1 Mg₂Siの固相合成

先行研究¹⁾から洗浄後のSi粉末と市販の純 Mg粉末(99.9%,フルウチ化学株式会社製)を 出発材料としている。不活性ガス(N₂)雰囲気下 の管状炉を用いて、原子状水素を発生させなが ら反応させた。このときの合成条件を表1に示 す。

合成時の原子状水素によるMgOの減少を評価するため、3種類の反応用の容器を用いた。 一つは市販の容器に蓋を被せない場合、二つ目 は容器に蓋をかぶせた場合、三つ目は実験用に

日大生産工(院)	○吉留	孝尭
日大生産工	清水	耕作

作製した回転容器である。Fig.1に回転容器の 概略図を示す。

衣1 固相合成采件		
Temperature[°C]	500	
Time[min]	60	
Gas type	Ar 95%, H_2 5%	
Feed pressure[MPa]	0.2	
Gass flow[sccm]	1250	
Hot-Wire Temperature[°C]	1400	
Sample Mass[g]	3.0	



Fig.1 回転容器の概略図

回転容器は円筒容器の蓋と底に \$4 mmの穴 があり、内部に攪拌羽根2枚を取り付けた容器 である。回転容器を用いて合成することで試料 が攪拌され、原子状水素を試料全体に接触させ ることが可能となる。そのため本実験では、回 転容器による合成方法と通常の容器での合成 方法と比較し、MgOの減少を確認した。

Fig.2に使用した管状炉全体の概略図を示す。 合成時に原子状水素を接触分解法で生成させ るため、 φ 0.3 mmのタングステン線(以降、 Hot-Wire)を管状炉内に導入している。本実験 では、合成時にはHot-Wireに電流を7~8 A加え 1400℃に加熱した。



Fig. 2 管状炉の全体概略図

Improvement of thermoelectric performance of Magnesium silicide by Atomic hydrogen.

Takaaki YOSHIDOME and Kousaku SHIMIZU

3.2 XRD

本実験では試料の同定のために、粉末X線回 折装置(Bruker社 D2 Phaser)を使用した。定 量分析のためにリートベルト解析を行い、解析 ソフトウェアとしてVESTA²)、RIETAN-FP³⁾ を使用した。

4. 実験結果および検討

Fig.3に合成時の容器ごとのXRD結果を示す。 Fig.3内のStandardは蓋無し容器、Coveredは 蓋有り容器、Rotationは回転容器を指す。各結 晶相の同定にはNIMS 物質・材料データベー ス (MatNavi) 内の無機材料データベース (AtomWork)を参考にした。4⁻⁶⁾



Fig.3 合成容器ごとのXRD結果

Fig. 3より、どの容器を用いてもMg₂Siの合成が可能であることがわかる。また、MgOとSiが検出されているため、合成時にMgが酸化されSiが未反応となったことが考えられる。

次に、Fig. 4にそれぞれ複数回行った合成実 験のXRD結果にリートベルト解析を行い定量 分析した結果を示す。同様に、Standardは蓋無 し容器、Coveredは蓋有り容器、Rotationは回 転容器を指す。それぞれのMgO濃度は Standardの平均値は6.2 mol%、Coveredの平 均値は4.6 mol%、Rotaionの平均値は3.4 mol% であった。

Fig. 4より、回転容器を使用することで蓋を かぶせた場合のMgO濃度より有為に減少する ことが確認できる。蓋が無い場合でMgO濃度 が高い原因として、管状炉壁面に物理的に吸着 した大気及び酸素が大量に存在することが考 えられる。さらに、原子状水素は試料表面付近 のみ接触し作用することが考えられるため、蓋 が無い場合では原子状水素の効果が回転容器 と比較して限定的であったことが考えられる。



5. まとめ

熱電性能の低下の原因となるMgOの除去について原子状水素を用いて行った。合成実験の結果から、原子状水素を発生させ回転容器を用いて合成することにより、MgOの濃度は有為に減少することが確認された。このため、Mg2Si熱電素子表面のMgOの除去による接合界面の改善が可能である。

今後の予定として、実際に熱電モジュールを 作製し、発電性能を評価することで原子状水素 による接合界面の改善性を評価、最適化する。

参考文献

- 1) 稲木光昭,熱電変換素子用廃シリコンの 洗浄方法とシリコン焼結体の物性評価, 卒業論文,日本大学生産工学部,(2016)
- 2) K. Momma and F. Izumi, J. Appl. Crystallogr., 44, 1272–1276 (2011).
- 3) F. Izumi and K. Momma, Solid State Phenom., 130, 15–20 (2007).
- 4) Mater. Trans., JIM,1992,33,,845-850,Noda Y., Kon H., Furukawa Y., Otsuka N., Nishida I.A., Masumoto K.,
- J. Alloys Compd., 1999, 282, 72-75, Karen P., Kjekshus A., Huang Q., Karen V.L.,
- Inorg. Mater., 1987, 23,, 1835-1837, Atdaev B.S., Grin' V.F., Sal'kov E.A., Chalaya V.G.,